

# Aka-Brief #14 铸铁

1



Piatto 220



水



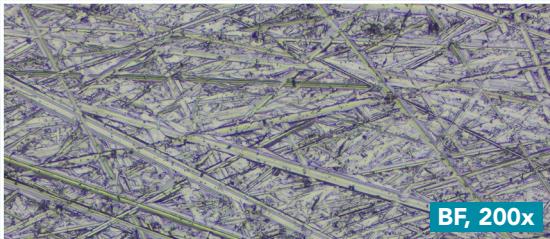
300 RPM



30 N

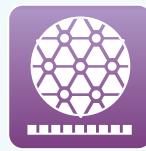


磨平



BF, 200x

2



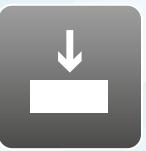
Allegran 3



DiaUltra  
9 µm



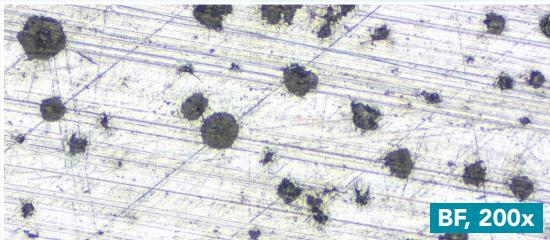
150 RPM



35 N



3:30 min



BF, 200x

3

\*\*\*



Silk



DiaUltra  
3 µm



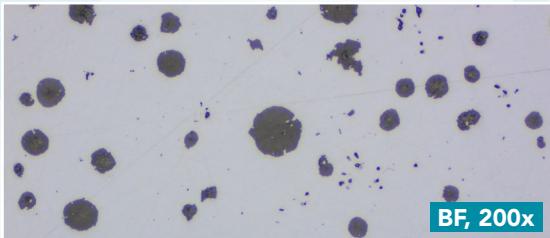
150 RPM



30 N



2:30 min



BF, 200x

4

\*\*\*\*



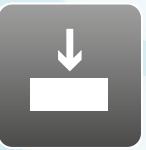
Chemal\*\*



Colloidal  
Silica 50 nm  
Alkaline



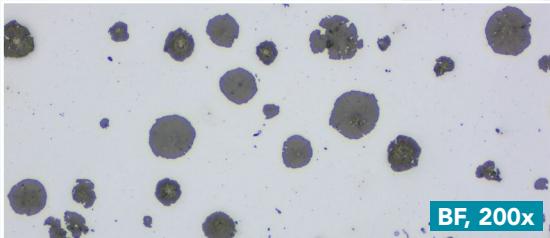
150 RPM



15 N



1 min



BF, 200x

图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加 100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

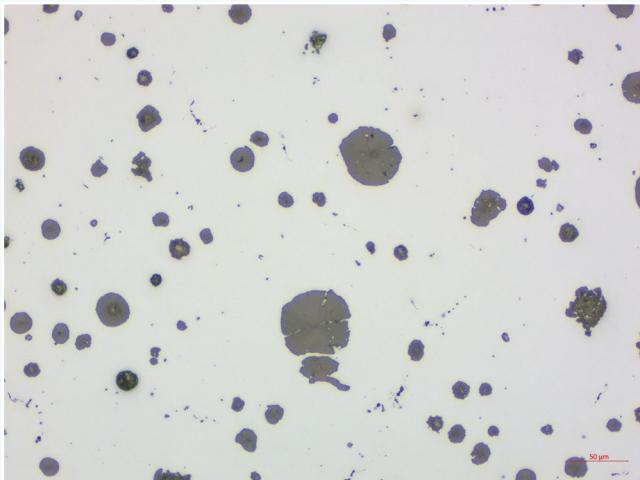
\*第四步是可选的。

\*\*开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

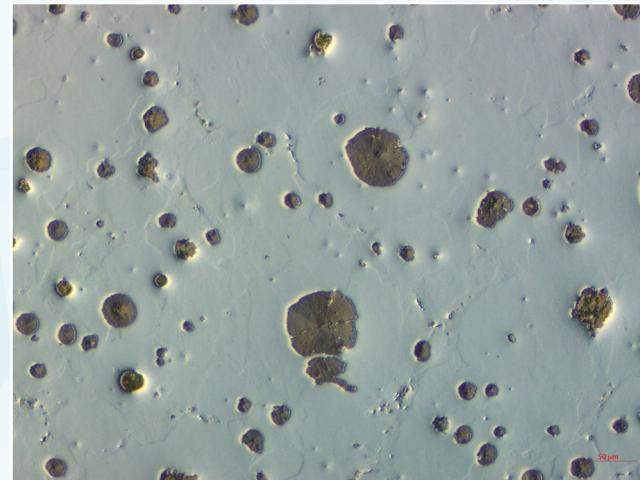
\*\*\*氧化抛光后能得到无划痕的样品表面，但是在样品表面会出现一些凹凸不平现象。为了减弱这种凹凸不平现象，可以使用 DiaUltra 1微米在Napal抛光布上进行终抛来代替这一步。

# Aka-Brief #14 铸铁

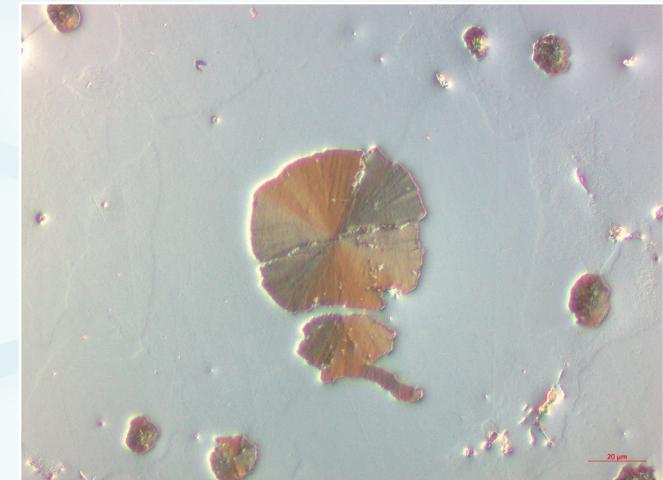
## 最终制样结果



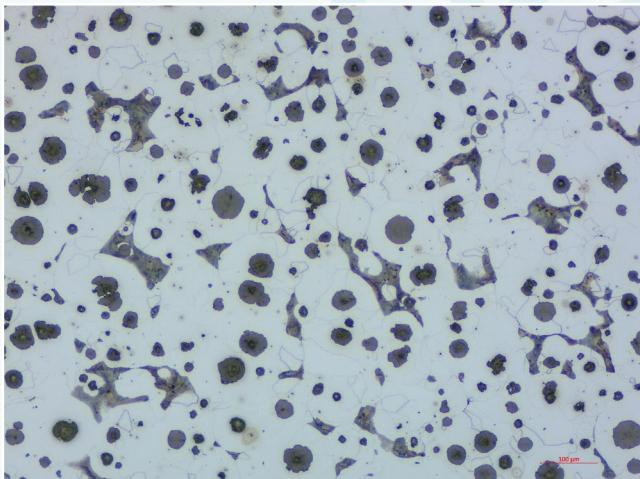
明场像, 200倍



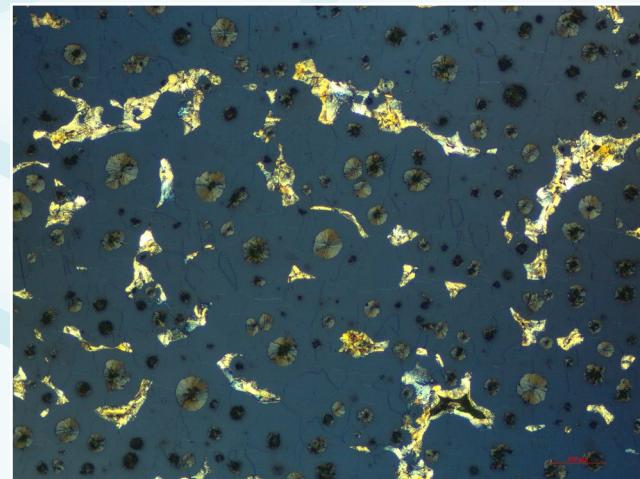
微分干涉衬度像, 200倍



微分干涉衬度像, 500倍



3%硝酸腐蚀, 明场像, 200倍



3%硝酸腐蚀, 偏正光, 200倍